



B. Patterning 분과

2019년 2월 15일(금), 11:00-12:30

Room E (스카이홀, 2층)

[FE2-B] EUV Lithography II

좌장: 이진균 교수(인하대학교), 안진호 교수(한양대학교)

<p>FE2-B-1 11:00-11:30</p>	<p>[초청] 극자외선 노광에 의한 웨이퍼의 열 및 구조적 변형 오세훈, 오혜근 <i>한양대학교 응용물리학과 광노광연구실</i></p>
<p>FE2-B-2 11:30-12:00</p>	<p>[초청] Interpretation of Line Edge Roughness in Extreme-Ultraviolet Resist from a perspective of Molecular Approach Juhae Park¹, Sung-Gyu Lee², Myungwoong Kim³, Hye-Keun Oh², and Su-Mi Hur¹ ¹<i>Polymer Science and Engineering Department, Chonnam National University,</i> ²<i>Department of Applied Physics, Hanyang University,</i> ³<i>Department of Chemistry, Inha University</i></p>
<p>FE2-B-3 12:00-12:15</p>	<p>열적 내구성 향상을 위한 복합구조체 펠리클 구조 제안 장용주¹, 위성주², 신현진², 김하늘², 안진호^{1,2,3} ¹<i>한양대학교 나노반도체공학과, </i>²<i>한양대학교 신소재공학과, </i>³<i>한양대학교 나노과학기술연구소</i></p>
<p>FE2-B-4 12:15-12:30</p>	<p>Removal of Particulate Contaminants from Backside of EUV Mask Using Dry Cleaning Hyun-Tae Kim¹, Nagendra Prasad Yerriboina², and Jin-Goo Park^{1,2} ¹<i>Department of Bio-Nano Technology, Hanyang University,</i> ²<i>Department of Material Science and Chemical Engineering, Hanyang University</i></p>